

# ボールニュース

Vol.121

## ろ過・分離・精製の問題解決



## 業界に滅菌バッグの新しい波



## ポールが滅菌バッグをはじめました!!!

## 超清浄で滅菌可能な通気性包装材 Cleansteam バッグ

## 微粒子管理の重要性

製薬業界において、微生物管理と同様に微粒子管理は常に取り組んでいくべき重要な課題です。各国の薬局方には、 医薬品に関する品質規格書、医薬品や生薬が収載されているほか、試験法や純度の基準・剤型などが記されています。 米国薬局方ひとつを例にとってみても、さまざまに記述されています。

## 米国薬局方における無菌操作基準の例

チャプター<1116> MICROBIOLOGICAL CONTROL AND MONITORING OF ASEPTIC PROCESSING ENVIRONMENTS (無菌操作環境の微生物管理とモニタリング)には、ヘルスケア業界において微生物が管理される環境は色々な用途が あること、そして、そのような環境で製造される製品は、無菌医薬品、無菌原薬、無菌中間体、賦形剤、医療機器が含まれ ていることが言及されています。無菌操作環境は、他の製造操作に使用されている管理環境よりも、患者のリスクに関 して極めて重要となります。

## 米国薬局方における注射剤の微粒子管理基準の例

また、チャプター<1> INJECTIONS(注射剤)において、「注射剤には、基本的にFOREIGN AND PARTICULATE MATTER (不溶性異物)はなきこと」との記載があるのみでした。新たなチャプター<790> VISIBLE PARTICLES IN INJECTIONS (注射剤中の可視性微粒子)では、さらに具体的な定義が示されることとなり、微粒子に対してより厳しい管理が求めら れることが明白です。

## 微粒子管理規制への対応 — 無菌包装材

薬局方以外にも、法規制や関連するさまざまなガイドラインで、微生物管理や微粒子管理が厳しく求められています。 日本は昨年7月に医薬品査定協定・医薬品査察協同スキーム(PIC/S)に加盟したことから、よりリアルタイムな情報共 有、グローバルな監視体制の実現に向かうことになりました。

こうした背景から、微生物管理と微粒子管理の両方に適した包装材は最新の業界動向に合致しているといえます。

## 滅菌プロセス用通気性包装バッグ

このような業界動向に対応して、当社では滅菌バッグの取り扱いを開始しました。医療用グレードのHDPE製で、通気性 に優れた医療用グレードのタイベック(Tyvek\*)を使用した製品として、CleansteamバッグとEasy-Tear Cleansteamバッグ があります。

ポールの滅菌バッグは、重要な材料の滅菌プロセスにおいて、最も厳しい要件を満たすように設計されています。清浄 度、素材強度、シール強度、微生物の侵入防止において優れた性能を発揮します。本製品は蒸気滅菌やEOG滅菌など 幅広い滅菌方法に対応しています。

Easy-Tear Cleansteamバッグはナイフやハサミを必要とせず、簡単に開封することができます。この革新的な方法は、粒 子の発生や刃物の使用によるグローブの損傷事故のリスクを実質的に解消し、アイソレーターや無菌環境下でのより安 全で効果的な使用を可能にします。



## NEW ポールが滅菌バッグをはじめました!!

超清浄で滅菌可能な通気性包装材 Cleansteam バッグ

## Cleansteam

### 用途

下記製品の蒸気滅菌とEOG滅菌

- 栓、キャップ、蓋
- 🌑 バイアル、容器
- シリンジ部品
- ラボ用またはプロセス用のステンレススチール備品
- 医療機器
- 無塵衣
- ※過酸化水素ガス(VHP)滅菌、ガンマ線滅菌、電子線滅菌など他の滅菌方 法にも対応しています。

## 特長

- 品質が保証されたバージンレジンを使用し、添加剤を加えず に清浄度の非常に高い環境下で製造したHDPEフィルム
- コーティングを施していないタイベック1073B(Tyvek\* 1073B)を自社で清浄化
- ISO クラス5のクリーンルーム内で製造
- 染色浸透試験(メチレンブルーを使用)でパッケージング のシール性を確認
- 開封と密封が簡単なEasy-Tearオプション
- ご要望に応じてカスタマイズ品のご注文も可能

## 利点

- 粒子数、バイオバーデンとエンドトキシンを低レベルに抑えた 非常に優れた高純度の清浄なバッグ(清浄度レベルを保証)
- 🌑 微生物の通過に対する優れた防御性
- 開封まで高い無菌性を維持
- バッグ開封時の発塵を低減(Easy-Tear製品)
- 破れや破裂に対する優れた耐久性
- 蒸気暴露時に色が変化する滅菌インジケーター
- 🌑 プロセスの効率化



## 品質基準

構成部品は以下の基準に適合

- FDA 21 CFR 177.1520 「オレフィンポリマー類」
- 食品接触プラスチック材料に関するEU指令 10/2011
- USP 最新版の生物学的安全性試験(in vitro)<87>
- USP 最新版の生物学的プラスチック安全性試験 (in vivo、クラスⅥ)<88>
- EP モノグラフ 3.1.3 「ポリオレフィン類」
- EU 2002/95/EC (RoHS: 特定有害物質使用制限)
- EMA/410/01(動物海綿状脳症病原体の伝播リスクの 最小化)

## 証明書サービス(有償)

- 赤外線検査レポート
- 清浄度、シール強度、寸法、表面抵抗(適用可能な場合)に 対する検査証明書
- エンドトキシンに対する検査証明書:1x LAL試験
- バイオバーデンの総生菌数(TVC)に対する検査証明書

#### ┉▶お問い合わせ

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【バイオファーマ事業部】TEL.03-6386-0995

## 輸液フィルターによる 輸液療法の安全性向上への買



医療機関での治療で一般的な方法の一つとして用いら れる"点滴"は、水分や栄養あるいは医薬品を時間をか けてゆっくりと静脈から体内に投与する療法です。ガー トル台に掛かった輸液剤から自然落差でポタポタと血 管内に投与する様子などから点滴という呼称が一般的 に定着していますが、専門的には"輸液"と呼びます。

医療機関では細心の注意を払っていますが、輸液は直 接患者の静脈に投与されるという特性から、細菌汚染 による感染症・敗血症や異物・空気混入による塞栓症を 引き起こすリスクがあります。ポールの輸液フィルター は、こうした輸液の潜在的なリスクを防ぎ、安全な輸液 療法を実現しています。

## 1. 輸液療法の目的

輸液療法の目的は下記の3つに分けられます。

1 体液管理 …… 脱水症状の改善、血液量・電解質量の維持等

2 栄養管理 …… 食事や水分補給が経口摂取できない場合に、必要な水分量や栄養素を補う

3 血管確保 …… 希釈を必要とする医薬品を体内に投与するための経路を確保する

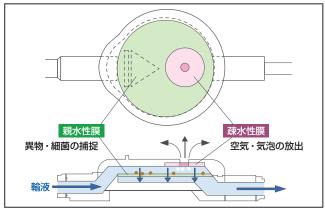
## 2. 輸液療法のリスクと輸液フィルター

輸液療法では複数の医薬品を混合して投与することが多く、 ガラス容器の医薬品やゴム栓を用いた容器の医薬品を混ぜ て患者に投与します。この時、ガラス容器を開封する際に目 に見えないほどの小さな破片や、ゴム栓に注射針を刺した時 のゴム片が医薬品に混入することが知られています。また複 数の医薬品を混ぜた輸液剤の中で化学変化が起こり、医薬品 ではない全く別の化合物として異物になることもあります。

また日常的に細心の注意が払われていますが、医療従事者の 薬剤混合・投薬行為において、真菌(カビ)や細菌、空気が予期 せずに輸液剤に混入してしまう事もあります。

ポール輸液フィルターELDやIV-5は孔径0.2μmという膜で 異物や細菌を捕捉し、さらに疎水性の膜で輸液剤に混入した 空気を大気中に放出して、患者の静脈に直接入る恐れのある リスクを除外します。





## 3. 小さな命を守る輸液フィルター

輸液療法をうけるのは成人だけとは限りません。新生児は成 人に比べて身体構成成分における水分の割合が高く、短時間 で脱水症状に陥りやすく、体液管理が大切となっています。

また、早産などで出生時の体重が2.500g未満の低出生体重 児、いわゆる未熟児は腸管が未成熟となっているため、輸液 による栄養補充が不可欠となっています。保育器の中で輸液 を受ける小さな体には大人のような異物や感染症に対する 抵抗力はありません。

1円硬貨ほどの大きさのNEO96やMicro-IVといった輸液 フィルターで、小さな命を守っています。



## 4. ポール輸液フィルター

日本ポールでは、自社のブランド製品に加えて、医療機器メーカー向けOEM製品もラインナップしています。成人向けおよび新 生児向けに下記のような製品をご用意しています。

日本国内だけではなく、世界中の医療機関でポール輸液フィルターは用いられており、長年の輸液療法の安全性を支えてきまし た。私たちはこれからも輸液フィルターを通じて医療の安全性の向上に貢献していきます。

製品写真				000	
販売形態	日本ポールによる製造販売製品		OEM供給製品(他社ブランドでの販売製品)		
販売名	ポール輸液フィルターELD		ポール輸液 フィルター リピポア	Micro-IV	IV-5
製品番号	ELD96LLC ELD96LYL ELD96NT	NEO96J NEO96LJ (新生児向け)	NLFLJ	69324421 69384421 (新生児向け)	7024400
親水性膜	ナイロン66		ポリエーテルスルホン		
疎水性膜	PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)				

┉▶お問い合わせ

'詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【メディカル事業部】 TEL.03-6386-0991

4

油圧潤滑機器の保護とコスト低減

## コラロン

## 作動油・潤滑油の寿命を延長し清浄度を改善

## フィルター性能をアップグレード

- 流量/圧力変動などのストレスに強いメディアの採用
- 流量-圧力損失特性に優れ、フィルターの小型化・ 長寿命化が可能
- フィルター寿命が尽きるまで安定したろ過性能を発揮し システム流体を安定して清浄に維持

## 既存フィルターと置き換えが容易

- ウルチポアⅢフィルターと同寸法
- ウルチポアⅢフィルターのハウジングに装着可能
- 従来製品との互換性保持
- 外→内流れ
- コラロンの製品型式は、既存フィルターエレメントのメディアグレードを示す "U", "D", "K", "M", "X"を"C"に置き換えるだけです。(右表参照)



## ■ コラロンの製品型式例

既存フィルター	コラロン
HC9600FKP8Z	HC9600FCP8Z
HC9601FDP13Z	HC9601FCP13Z

#### ウルチポアⅢフィルターアッセンブリーをご使用の場合



## フィルター性能のアップグレードで、より一層の機器の保護とコスト低減を

コラロンへの置き換えで

- 流体清浄度が改善
- 安定した流体清浄度を維持
- 圧力損失を低減
- ハウジングはそのまま使用可

**メルメント価格は同じです** 

- ✓ 清浄度改善効果(2倍)
- ✓ 流体清浄度の安定化(2倍)
- ✓ 最大で5%のろ過コストの低減
- 油圧・潤滑装置の運転コスト削減に貢献します。

## ウルチポアⅢハウジングで他社製フィルターエレメントをご使用の場合



#### フィルター性能のアップグレードで、機器保護の改善とコスト低減を

コラロンへの置き換えで

- 流体清浄度が改善
- 安定した流体清浄度を維持
- 圧力損失を低減
- ハウジングはそのまま使用可

## 悩む必要はありません

- ✓ 清浄度改善 (~15倍)
- ✓ 流体清浄度の安定化(~16倍)
- ✓ 最大で20%のろ過コストの低減
- 油圧・潤滑装置の運転コスト削減に貢献します。

┉▶お問い合わせ

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【メカトロニクス事業部】TEL.03-6901-5790



## 高性能製品群で幅広い用途に対応し、コスト削減に貢献します

## ポール・バグフィルター



- ■各種水処理
- 不凍液
- メッキ液、コーティング液
- 排水、冷却水
- 化学製品全般
- **潤滑油**

- ■洗浄液、加工クーラント
- **塗料**
- ■燃料、バイオ燃料

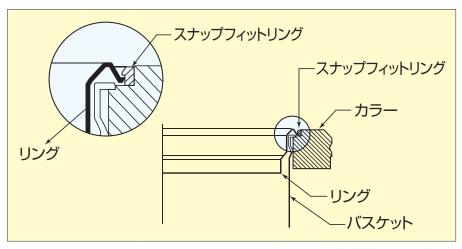
## 特長

- 多様な素材、形状のバグフィルター製品群
- 様々なニーズに対応できるバグフィルター用ハウジング
- 粗ろ過から除去効率98%までの各種グレード
- バグフィルターの高性能化による製品ロス、ダウンタイム低減
- 特許取得のポリロック構造による高いシール性





■ ポリロック構造













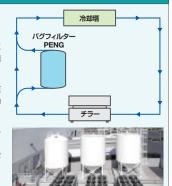
## 冷却水

適用例 : 冷却塔(冷却水) 使用目的:冷却水の清浄度保持

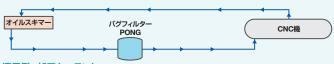
300機の冷却塔を有するある学校では、水中の異物に よるスプレーノズル閉塞対策のメンテナンス費に問題 を抱えていました。

スプレーノズルの閉塞は冷却塔のオーバーヒートの原 因となり、さらに、パイプ等を閉塞させて冷却塔を交換 することになります。

この事例では、バイパスラインに25μmのバグフィル ターを設置し、流量の10-20%のろ過を行いました。 その結果、冷却塔の大幅な寿命延長とメンテナンス費 を削減することができました。



## 工作機械加工クーラント



適用例:加工クーラント

目的 : クーラントからの微細ガラス片、オイル、その他異物除去

レーザー用ガラスは、滑らかな加工面と清浄度が求められます。 この工場では、CNC旋盤でこのレーザー用ガラスを加工しています。

改善前: この加工クーラントは油分を除去するために、まずオ イルスキマータンクに送られます。その後、50μm、 10µm、0.3µmの3段階のカートリッジフィルターで ろ過されていました。フィルターを毎日交換したにも

かかわらず、不良率が10%以上ありました。

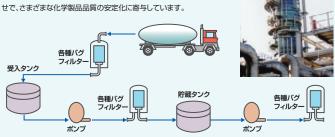
改善後: この3段のろ過を、バグフィルター"PONG"の単段ろ 過に置き換えました。その結果、フィルター寿命は5日 に伸び、かつ不良率は5%以下に低下しました。



## 化学製品送液ライン

適用例 : 化学製品・送液ライン 使用目的:製品からの異物除去

各工程で送液される化学製品への異物混入は製品品質に影響します。 ポリロック構造のハウジングと溶着タイプのバグフィルターの組み合わ

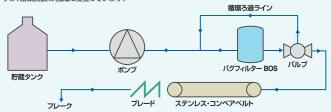


## 化粧品原料

適用例:酸アミド

目的 : 製品の清浄度、透明度確保

酸アミドは、クリーム、ローション、整髪料などに使用されます。この事例では、酸アミドをフィルターハウジン グ(FSPN40)に入れたバグフィルター(BOS10PM1P)でろ過しています。この酸アミドは冷却されたステン レス・コンベアベルトに送られ、薄い板状に固化されます。その後フレーク状に砕かれて製品となります。これ らの化粧品用途に適合する製品とするため、酸アミドは、所定のレベルの透明度に達するまで循環ろ過されま すが、循環回数の低減に役立っています。



## ペイントライン

適用例:自動車のペイントライン 使用目的:塗装品質の向上

自動車の電着塗装工程には、表面処理工程や多段の洗浄工程があり ます。それぞれの洗浄、処理槽の清浄度は、塗装面品質に大きく影響し ます。ポリロック構造のハウジングと溶着タイプのバグフィルター "PONG"の組み合わせで各工程で使用され、洗浄液、処理液の清浄度 向上に大きく寄与しています。



化成処理

水 洗

各槽の循環ろ過用バグフィルター "PONG"

## メッキライン

適用例 : 各種メッキ液 使用目的:メッキ品質の向上

良質なメッキを行うにはメッキ面の清浄度に加えてメッキ液の 洗浄度が重要となります。

ポールのポリロック構造バグフィルターは、異物ばかりでなく油 分除去も可能です。その結果、メッキ液槽の循環ろ過において、 メッキ液の清浄度向上に寄与します。

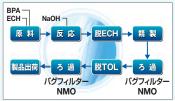


## エポキシ製造工程

適用例 : エポキシレジン 使用目的:エポキシ品質の向上

エポキシは高粘度の流体であり、リングシール 部やバグフィルターの破損部などからリーク することがあります。

ポールのポリロック構造のハウジングに加え て、目開き径が一定で高粘度流体のろ過に適 した単繊維メッシュタイプのバグフィルター をお使いいただくことで、高精度なろ過を実 現できます。





### 洗浄機

適用例 : 洗浄液のろ過

使用目的:洗浄水の清浄度向上、ポンプ寿命の延長

機械部品の製造ラインには、加工後の製品を洗浄する洗浄機が設置されています。

洗浄液の清浄度向上は部品清浄度に影響を与えますが、最近の高圧洗浄機などでは高圧ポンプのメン テナンスコストにも大きく影響します。ポールでは、ろ過性能とろ過寿命の両方のニーズをバランス良く 満足できるバクフィルターを推奨しています。

┉▶お問い合わせ

、詳しい内容につきましてご質問がありましたら、 下記までお問い合わせください。

【メカトロニクス事業部】 TEL.03-6901-5790

## 電着塗装欠陥の低減

## 第一次。1970年的**的**链线分传是

- 鉄粉の90%以上を捕捉
- ステンレススチール製
- コンパクトなカートタイプ
- 入口バルブは故障時閉となるフェイルクローズ
- 完全自動運転で自動洗浄
- PLCコントロール

## マグネットセパレーター FerrX5000R



FerrX5000Rは、自動車など、塗装前に洗浄を行 う溶接製品の洗浄液から鉄粉を除去するマグネ ットセパレーターです。

特許取得済みの技術により、レアアースを配合し た強力磁石で鉄粉を捕捉します。捕捉された鉄 粉は自動洗浄により磁石から掻き落とされ、排出 ラインから排出されます。すべて全自動運転です ので、日々のメンテナンスは不要です。

化成前処理槽での運転実績では、1週間で30~ 60kgの鉄粉除去効果が確認されています。化成 前処理槽での設置では、電着塗装欠陥を50%以 上低減できた事例もあります。

磁石	10,000 ガウス 以上
最高使用圧力	0.69 MPa
最高使用温度	80 ℃
材質	ハウジング : ステンレススチール 本体 : カーボンスチール
接続	3" フランジ ANSI 150#
設計流量	1,130 L / min
電源	3相380-480V,50/60Hz
サイズ	1,524 cm (L) × 610 cm (W) × 1,981 cm (H)

┉▶お問い合わせ

「詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【メカトロニクス事業部】TEL.03-6901-5790

## ト語テイロンフィルタ

## 更なる欠陥低減と歩留まり向上

## 微小欠陥検出技術の向上

スマートフォンを始めとする電子機器の進化とともに、最先端半導体デバイス製造に対する要求は益々厳しくなっています。 半導体デバイス製造各社は、性能面だけではなくコストについても優位性を確保する必要があります。ウェハー製造工程にお ける欠陥を低減させ、製品歩留まりを向上させることがその要求に応するための重要な手段であると言えます。

先端半導体製造において、リソグラフィエ程はパターン形成の核となる工程です。近年の各種ウェハー欠陥検査装置の技術進 歩も著しく、これまで検出することのできなかった微小な欠陥が検出されるようになりました。このため、ディフェクト(欠陥)低 減に対するフィルターの役割がさらに重要になっています。

## レジスト中の難溶解性成分の除去

## 1 親水性基を持つナイロン6,6の表面物性効果

リソグラフィ工程で使用されるフォトレジストろ過用フィルターとして、当社では、ナイロン6,6膜を使用したフィルター(製品 名:ウルチプリーツ・P-ナイロン)を推奨しています。ナイロン6,6は、ユニークな表面物性を持ち、フォトレジストを始めとす るリソグラフィ樹脂溶液中の難溶解性成分を効果的に吸着除去します。その結果、パターニング後の「ブリッジ」と呼ばれる ディフェクト低減に効果を発揮します。特にArF以降のDUV<sup>1</sup>フォトレジストにおいてその効果が顕著であり、多くのお客様 に採用されました。 \*1 DUV: Deep UV(遠紫外線)

図1は、リソグラフィ用途で主に使用される3種類のフィルターメディア 材質の分子構造式です。ナイロン6.6は、ポリエチレンやPTFEと異な り、「親水性基」を持っていることが特徴です。



図1:メディア材質の分子構造式

## 2 レジスト中の難溶性成分形成の原理と除去のメカニズム

製造工程における欠陥原因となっているのは、ArFレジスト中の難溶性成分といわれています。この難溶性成分は、レジスト 中のポリマーの、疎水性基あるいは親水性基の微妙な偏りによって形成されるものと考えられています。

溶媒が疎水性の場合、親水性基が偏って集まった部分は不安定な状態にあり、これらの部分がディフェクト予備軍になると考 えられています。この部分が不安定な状態にあると、表面積を減少させようとして凝集する傾向があります。【図2参照】

レジスト中の不安定な難溶性成分は、親水性基を持つNylon6,6膜フィルターでろ過した際に、溶媒中に存在するよりも安定 した状態となります。ナイロン6,6の親水性基と親水性ゲルが会合して安定化し、フィルターメディアの親水性基に吸着除去 されるものと考えられます。【図3参照】

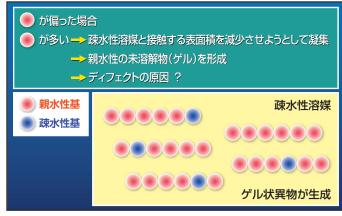


図2: 樹脂溶液中の難溶性成分形成の原理

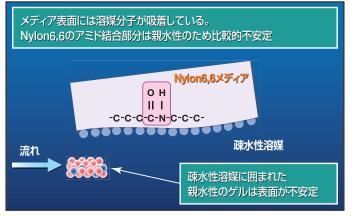


図3:ナイロン6.6による難溶性成分除去のメカニズム

## ロンフィルターの進化

## ナイロン効果の検証

実際にArFレジストを用いて、各種フィルターによるウェハー 上のブリッジディフェクトを検証しました。【図4参照】

材質、ろ過精度が異なる4種類のフィルターにおいて、フィ ルター装着前と装着後のマイクロブリッジディフェクトの 欠陥密度を測定し、その差(除去能力)を計算によって算出 しました。

HDPE(高密度ポリエチレン)、ナイロン6.6ともに、細かな ろ過精度の方が高い除去能力を示すことが確認できます。 着目したいのは、HDPE/10nmとナイロン6,6/20nmとの 比較です。

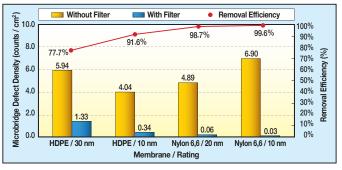


図4: ArFレジストでのマイクロブリッジディフェクト

出典: T.Umeda, S.Tsuzuki, T.Numaguchi, "Defect Reduction by using Point-of-use Filtration in a New Coater/Developer", Fig.2, SPIE 2009

ろ過精度としてはナイロン6.6の方が粗い表記となっていますが、実際のマイクロブリッジディフェクト密度ではその結果が 逆転しています。この結果、ナイロン6,6による難溶性成分の効果的な除去性能(ナイロン効果)が検証され、その優位性を 確認することができました。

## ナイロン効果最適化の条件

次に、このナイロン効果を最適化させるための条件を検証し ました。【図5参照】

重要となるパラメータは、①**コンタクトタイム(接液時間)**と ②**ろ過圧力**です。樹脂溶液にメタルを添加させた試験溶液 において、添加したメタルの除去能力をこの2つのパラメー 夕によって検証したところ、以下の傾向が確認されました。

- ①コンタクトタイム → 長いほど効果的 → フィルターメディア体積の増大
- ②ろ過圧力 → 低いほど効果的 → フィルター圧力損失の低減

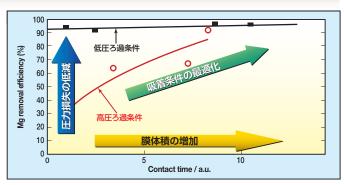


図5:ナイロン6,6の難溶性成分の吸着

## 大流量低圧損 5 nm ナイロンフィルターで歩留まり向上

フィルターメディアの一般特性として、ろ過精度が細かくなると、圧力損失が上がります。次世代半導体デバイス製造向けフ ォトレジストのろ過では、細かいろ過精度でも圧力損失が低く、さらに効果的に除去を行うことが要求されています。これに 対応して、新製品「ハイフロー・P-ナイロン」を開発しました。従来のナイロンフィルターよりも、さらに緻密かつ体積の大き な膜構造を持ちながら、従来製品比で半分以下の圧力損失値を達成しています。\*【図6、7参照】\*当社10nm/P-ナイロンとの比較

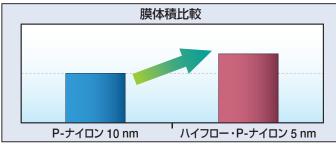


図6:10nm/ウルチプリーツ·P-ナイロンと5nm/ハイフロー・ P-ナイロンの膜体積比較

ナイロン効果を最大限に発揮させるために開発された5nm"ハ イフロー・P-ナイロン"は、すでに一部のお客様での先行評価 でその優位性が確認されており、自信を持ってお奨めできる製 品に仕上がっています。当社では、高まるご要望にお応えして、 今後も、お客様とともに更なる製品開発を続けてまいります。

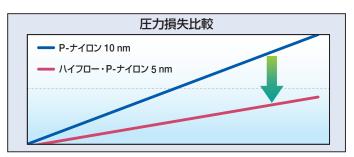


図7:10nm/ウルチプリーツ·P-ナイロンと5nm/ハイフロー・ P-ナイロンの圧力損失比較

┉▶お問い合わせ

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、 下記までお問い合わせください。

【マイクロエレクトロニクス事業部】TEL.03-6901-5700

## お客様のコスト低減に貢献



## 『コ1000 微量水

ガスクリーン・ピコ1000は、窒素プロセスガスに含 まれる微量の水分(検出限界1ppb<sub>v</sub>)を測定する微 量水分計です。このシステムは、超高純度のプロセ スガスラインの適性確認と認証取得に最適です。ま たガス精製器の下流に設置すると、ガス精製器の寿 命を検知します。持ち運びしやすい堅牢でコンパク トな設計により、施設内でプロセスガスの迅速な品 質検査が必要な多くの場所へ簡単に移動(持ち運 び) することができます。またガスクリーン・ピコ 1000は、他社の分析計に比べ、分析に使用するプロ セスガス(サンプリングガス)の消費量を最高70% 削減します。



ガスクリーン・ピコ1000 窒素ガス中微量水分計

#### 特 長

- プロセスガスに含まれる水分の濃度に合わせてサンプリング時間を自動制御
- 水分(窒素ガス中)の検出限界はわずか1ppb、(サンプリング時間10分の場合)
- 診断パラメーター監視機能、およびわかりやすいシステムチェック機能を内蔵
- 設置後すぐに使用できる簡単な「プラグ&プレイ」機能を搭載

#### 利 点

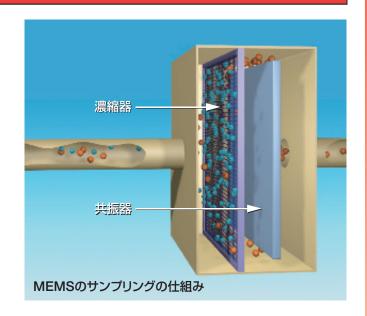
- 分析現場への移動に便利な軽量デザイン
- 競合製品に比べ所有コストを20%低減
- 速い応答時間

- プロセスガスラインのリークを検出
- ガス精製器の寿命を検知
- CRDSシステムに比べプロセスガスの消費量を70%削減

## 3 測定原理

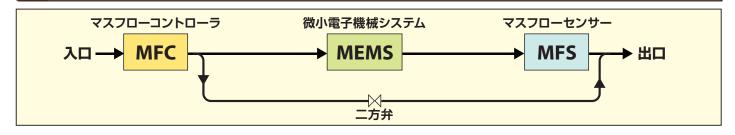
ガスクリーン・ピコ1000は、MEMS(マイクロマシン:微小電 子機械システム)を用いて水分濃度を重量測定します。サン プルのプロセスガスは、マスフローコントローラを通過して 独自のコーティングを施した濃縮用MEMS(1段目)に達し、 ここでサンプリングガス全体の水分が捕集されます。サンプ リングが終了すると、濃縮器は1,000分の数秒で瞬時に加熱 され、捕集した水分を「フラッシュオフ:脱離」します。

濃縮器MEMS(1段目)のすぐ隣には、MHzの周波数帯で振 動する共振用MEMS(2段目)が搭載されています。この共 振用MEMSには濃縮器MEMSとは別の独自技術で化学選 択的コーティングを施し、濃縮器からフラッシュオフした水 分の吸着・脱着性能を高めました。この独自設計により、共振 器に吸着された水分の質量が迅速に検出・測定できます。



共振器が特定のMHz帯に振動すると、測定サイクルが開始されます。濃縮器が水分をフラッシュオフし、共振器の周 波数帯の変化( $\Delta$ Hz)が発生すると、これを検知して水分の質量に正比例する電気信号が発せられ水分濃度を算出し ます。サンプリングは連続的実施されます。濃縮器が水分をフラッシュオフし、共振器がこれを測定する間のみ途切れ ますが、この間はわずか数秒です。ガスクリーン・ピコ1000は、連続サンプリングとバッチ測定により、ほぼリアルタイ ムで水分濃度を分析します。

## フロー図



## 持ち運び用ケース付(製品出荷時に同梱されます)





水分計本体の寸法: 幅44.6 cm x 奥行28.8 cm x 高さ17.6 cm、11.4 kg

#### 6 仕 様

## 性能

測定範囲(濃度)	1 ppb <sub>v</sub> - 3 ppm <sub>v</sub>	
検出下限(LDL)	1 ppb <sub>v</sub> (8 ppb <sub>v</sub> にて3σ範囲によるLDL値を確認)	
正確度: 1-200 ppb <sub>v</sub> 201-3,000 ppb <sub>v</sub>	± 1 ppb <sub>v</sub> あるいは ± 10%のどちらかより大きい方 ± 20%	
精度(再現性)	± 5% (全測定レンジ)	
サンプリング時間	10分(0 – 50 ppb <sub>v</sub> ) 2.5分(50 - 200 ppb <sub>v</sub> ) 30秒(200 ppb <sub>v</sub> - 3 ppm <sub>v</sub> )	

## ■ 設計パラメーター

測定法	MEMS (マイクロマシン) 共振器を用いた重量分析法
分析対象物	H <sub>2</sub> O(微量水分)
寸法、重量	幅 44.6 cm x 奥行 28.8 cm x 高さ 17.6 cm、11.4 kg
ガス導入口継手	1/4"ガスケットシール、オス継手(VCR1対応)
ガス排気側継手	1/4"コンプレッションシール、オス継手(スウェジロック²対応)
接ガス部品の内表面粗度	< 0.25 μm / 10 μinch Raの内面仕上げ(MFCは、< 0.41 μm / 16 μinch Ra)
ヘリウムリーク率	< 2 X 10 <sup>-8</sup> mbar·L / sec
保管温度	-30°C (-22°F) ~ 80°C (176°F)
設置条件	幅 483 mm(19 inch)の棚収納 もしくは、机上設置
装置の定格	Installation Category II, Pollution Degree 2 に準拠
認証所得済規格	CSA規格、UL規格、CE規格、WEEE規格、ISTA 1 A規格
米国特許番号	US 6,511,915; US 6,627,965; US 6,953,977

## ■ 使用条件

適合ガス種	窒素ガス
サンプルガス温度	5°C (41°F) ~ 30°C (86°F)
サンプルガス流量	280 sccm ± 1%
測定環境条件	0°C (32°F) ~ 30°C (86°F)
サンプルガス入口圧力	69 kPa (10 psig) ~ 310 kPa (45 psig)
サンプルガス出口圧力	101 ± 7 kPa 絶対圧(14.7 ± 1 psia) 500 m 以上の排気ラインへの接続が必要な場合は当社にお問い合わせください

## 電気条件

電源条件	100-240 VAC 50 / 60 Hz(± 10%内の電圧供給とし、使用は室内限定)
消費電力	60 W平均(スタートアップ時の90 Wをピーク)
入力/出力(アナログ/デジタル)	4 - 20 mA 0 - 5 VDC 2つのUSB 1.1ポート 7"サイズのLCDタッチパネル入力操作 USBダウンロード可能なcsvデータ・ファイルによる出力またはアナログ信号 RS232C通信シリアルポート(工場サービス診断コミュニケーションのみ)
警報	4つのユーザープログラム化が可能なフォームCリレー

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>VCRはスウェージロック社の商標

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【マイクロエレクトロニクス事業部】 TEL.03-6901-5700



 $<sup>^2</sup>$ スウェージロックはスウェージロック社の商標

## Technical Paper 技術論文



## 多孔質メンブレンフィルターによる CMPスラリーの粗大粒子低減

### 日本ポール株式会社 応用技術研究所 角屋 正人

本稿は、ICPT2014において、原題: "Large Particle Reduction by Porous Membrane Filter" で発表した内容を編集したものです。

### 1. はじめに

ろ過は、CMP (Chemical Mechanical Polishing) 工程 においてマイクロスクラッチ(微小研磨傷)欠陥の発生を 低く維持することに貢献してきた。これまでCMPスラリー のろ過には、開孔径が大きく長寿命のデプスフィルター (メルトブローファイバー製)が多く使用されてきた。最近、 CMPスラリーの砥粒濃度、砥粒径が低く小さくなる傾向に あり、さらなるマイクロスクラッチ低減のために小孔径で 密な構造の多孔質メンブレンフィルターを使用しても、あ る程度のろ過寿命が見込めるようになった。

フィルターを新たに評価する際には、CMP工程での評価に 先立つスクリーニングとして、ろ液の粗大粒子数(LPC) を確認することが一般的に行われる。しかし使用されるフ ィルターのろ過精度が0.5μmより細かくなっている現在 では、粒径0.5~1 μm以上のLPCを測定する従来の方法で は、フィルター間に違いが見られないことも多い。

そこで、多孔質メンブレンフィルターと従来型のデプスフ ィルター間のろ液中LPCの違いを示すため、新型のパーテ ィクルカウンターによる0.2μm以上のLPC測定および、 ろ液を通液した評価用フィルターの差圧上昇からのLPC相 対比較を試みることにした。本研究では、代表的なろ過精 度の細かいデプスフィルターと多孔質メンブレンフィルタ 一を使い、コロイダルシリカスラリーおよびセリアスラリ 一に対するLPC低減効果を比較した。

#### 2. コロイダルシリカスラリーのろ過

#### 1. 試料

#### 1) 試験液

平均粒径20nm、砥粒濃度20mass%のコロイダルシリ カスラリー

## 2) 試験フィルター

デプスフィルターA:メルトブローファイバー製デプスフィルター メンブレンフィルターB:ナイロン66製多孔質メンブレンフィルター ろ過精度0.2 um

#### 2. 試験装置

パーティクルカウンター アキュサイザー\*1 FXナノ (※1 PSS社の商標) 粒度分布計 ゼータサイザー\*2 ナノZS (※2 マルバーン社の商標) コントロールメンブレン試験装置 (図1参照)

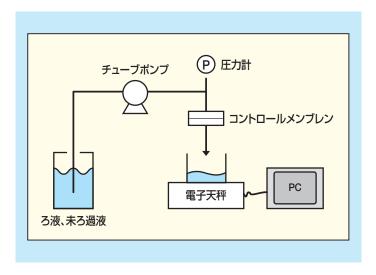


図1:コントロールメンブレン試験装置

#### 3. 試験方法

#### 1) ろ過

コロイダルシリカスラリーを、試験フィルターにより 100g/minの流量でろ過し、1kgのろ液を採取した。



#### 2) LPC測定

ろ液および未ろ過試験液中の0.2μm以上のLPCをパーテ ィクルカウンターにより測定した。

#### 3) コントロールメンブレン試験

孔径0.6 µmトラックエッチメンブレンをコントロールメ ンブレン(液清浄度の評価用フィルター)として、これに 未ろ過試験液、ろ液を3g/minの定流量で通液し、通液量 に対する差圧を測定した。コントロールメンブレンの差圧 上昇は、試料中のLPCが少ないほど低く、LPCの指標と 考えられている。

#### 4) 粒度分布測定

ろ過により必要な砥粒までが捕捉されていないことを確認 するため、各ろ液と未ろ過試験液の粒度分布を粒度分布計 により測定した。

#### 4. 結果および考察

図2は、粒径0.2μm以上のLPC測定結果である。ろ液の LPCは、未ろ過試験液に比べ著しく減少した。ろ液間で 比較すると、メンブレンフィルターBの方が、デプスフィ ルターAよりLPCが約10%低かった。しかし差が小さい ため、この結果のみで、メンブレンフィルターBの方がデ プスフィルターAよりLPC低減に優れていると結論づける のは困難である。

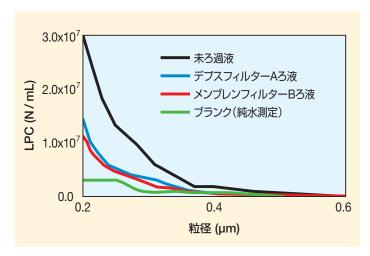


図2:パーティクルカウンターにより測定されたLPCの比較

図3は各ろ液、未ろ過試験液をコントロールメンブレンに 通液したときの差圧上昇である。LPCと同様に、ろ液と未 ろ過試験液間に顕著な差圧上昇の違いが見られた。ろ液間 で比較しても、メンブレンフィルターBとデプスフィルター Aの間に明確な差が見られた。

LPC測定結果、コントロールメンブレン試験結果を総合す ると、メンブレンフィルターBはデプスフィルターAよりも LPC低減に優れた性能と言える。粒度分布測定によると、 各ろ液と未ろ過試験液の粒度分布に差は無かった。研磨に 必要な砥粒が除去されずにフィルターを通過していること を確認した。

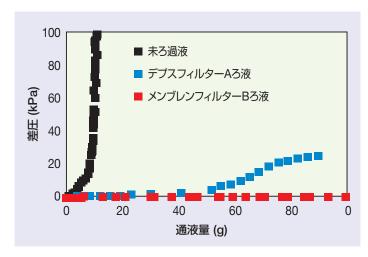


図3: コントロールメンブレンの差圧上昇比較 流量3g/min、温度18.3~19.4℃ 孔径0.6µm トラックエッチメ ンブレンをコントロールメンブレンとして使用

### 3. セリアスラリーのろ過

#### 1. 試料

#### 1) 試験液

平均粒径120 nm、砥粒濃度2mass%のセリアスラリー

#### 2) 試験フィルター

デプスフィルターA:メルトブローファイバー製デプスフィルター メンブレンフィルターB:ナイロン66製多孔質メンブレンフィルター

ろ過精度0.2μm

メンブレンフィルターC:ナイロン66製多孔質メンブレンフィルター

ろ過精度0.45μm

#### 2. 試験装置

パーティクルカウンター、粒度分布計、コントロールメン ブレン装置は、2.2記載の装置と同じ。

#### 3. 試験方法

1) ろ過、LPC測定、粒度分布測定

前記試験と同じ方法。

#### 2) コントロールメンブレン試験

未ろ過試験液、ろ液を純水により2倍希釈した後に通液し たこと以外は、前記試験と同じ方法。

#### 4. 結果および考察

メンブレンフィルターBについては、試験液ろ過時に急激 な差圧上昇を示したため以降の検討は行わなかった。

図4は、粒径0.2μm以上のLPC測定結果である。メンブ レンフィルターCろ液のLPCは未ろ過試験液に比べ6%減 少したが、差が小さいため、この結果のみでメンブレンフ ィルターCが本スラリーのLPC低減に寄与すると結論づけ るのは困難である。



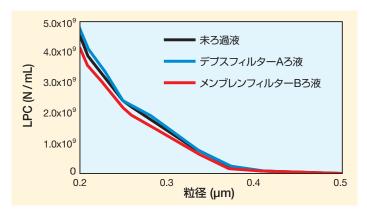


図4:パーティクルカウンターにより測定されたLPCの比較

図5は、各ろ液、未ろ過試験液をコントロールメンブレン に通液したときの差圧上昇である。メンブレンフィルター Cろ液と未ろ過試験液間で顕著な差が見られた。LPC測定 結果、コントロールメンブレン試験結果を総合すると、メ ンブレンフィルターCは本スラリーのLPC低減に寄与する 性能と言える。粒度分布測定によると、各ろ液と未ろ過試 験液の粒度分布に差は無かった。研磨に必要な砥粒が除去 されずにフィルターを通過していることを確認した。

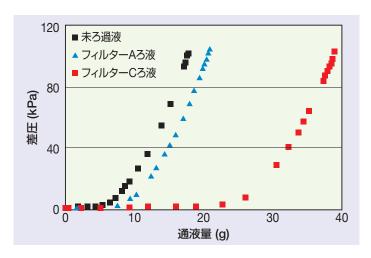


図5: コントロールメンブレンの差圧上昇比較 2倍希釈後通液、流量3g/min、温度20.7~22.1℃孔径0.6μm トラックエッチメンブレンをコントロールメンブレンとして使用

## 4. コントロールメンブレン試験の粗大粒子検出感度

#### 1. 目的

前記試験のろ液清浄度評価で用いた「コントロールメンブ レン試験」が、スラリー中に混在する粗大粒子を高感度で 検出する方法であることを示す。

### 2. 試料、装置

#### 1) 試験液

前記試験と同じコロイダルシリカスラリー。

#### 2) 粒度分布計、ろ過装置

前記試験と同じ装置。

#### 3) ビーズミル

ビーズミルDMS-65(アシザワファインテック製)

#### 3. 試験方法

- 1) コロイダルシリカスラリーを100℃で加熱、乾燥させシ リカ粒子塊を得た。
- 2) 粒子塊を純水とともにビーズミルに入れ粉砕し、凝集シリ 力粒子の懸濁液を作成した。
- 3) 水分散液の粒度分布、粒子濃度を測定した。
- 4) 粗大粒子の少ないコロイダルシリカスラリー (メンブレン フィルターBろ液)に、凝集シリカ粒子が10ppmの濃度 になるように懸濁液を加えた。
- 5) スラリーをコントロールメンブレン (孔径0.6 µmトラッ クエッチメンブレン)に通液し、差圧の上昇を測定した。
- 6) 通液後のコントロールメンブレンを通水洗浄、乾燥させ、 表面を走査型電子顕微鏡により観察した。

#### 4. 結果、および考察

図6は、コントロールメンブレンの差圧上昇である。比較 対照のために、図3に示した未ろ過スラリー、メンブレン フィルターBろ液を通液したときの差圧を併せて記載した。 メンブレンフィルターBろ液を通液したとき、コントロール メンブレンにほとんど差圧上昇は無いが、10ppmの凝集粒 子を添加したスラリーを通液すると急激に差圧上昇し、未 ろ過スラリーを通液した場合に近くなった。他方、凝集粒 子の10ppm懸濁液を通液しても差圧上昇は無かった。この 結果は、高濃度で微小なシリカ分散粒子中に、粗大な凝集 シリカ粒子が低濃度であっても混在することによりコント ロールメンブレンの差圧が上昇することを示唆している。

フィルターに捕捉された粗大粒子が、フィルターを通過す る微小粒子の凝集を誘発することが報告いされており、コン トロールメンブレン上でも同じ現象が起こり、閉塞の進行 が加速されると想定される。

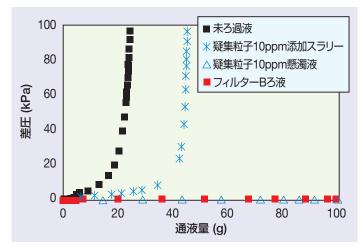


図6: コントロールメンブレンの差圧上昇比較 流量3g/min、温度22.6~23.5℃ 孔径0.6µm トラックエッチメ ンブレンをコントロールメンブレンとして使用



図7は、凝集粒子添加スラリーを通液した後のコントロー ルメンブレンの状態である。多数の粒子が見られるが、角 のある粒子は添加した凝集粒子、その他は分散シリカ粒子 がコントロールメンブレン上で凝集したものと考えられる。

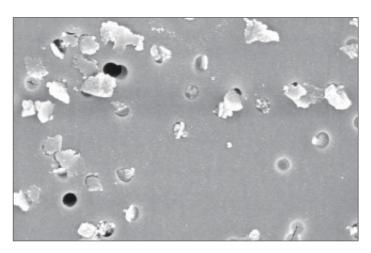


図7:通液後コントロールメンブレンの捕捉粒子

## 5. おわりに

多孔質メンブレンフィルター、デプスフィルターにより CMPスラリーをろ過し、LPC低減効果をパーティクルカウ ンターとコントロールメンブレン試験により評価した。そ の結果、両者の併用が多孔質メンブレンフィルターによる LPC低減を示すために有効であるとわかった。

#### 参考文献

[1] 渡辺史武、廣瀬聡、塚崎和生、角屋正人、沼口徹、「CMP用研磨スラリー(SiO2)のフィルター寿命に対する粗大粒子の影響」、化学工学会第39回 秋季大会要旨集、A209、2007年

┉▶お問い合わせ

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【マイクロエレクトロニクス事業部】TEL.03-6901-5700





## 日本ポール株式会社

●マイクロエレクトロニクス事業部 ☎03(6901)5700 ●エナジー事業部 ☎03(6901)5780 ●メカトロニクス事業部 ☎03(6901)5860 ●エアロスペース事業部 ☎03(6386)0995 ●ラボラトリー事業部 ☎03(6386)0993 ●食品事業部 ☎03(6386)0991

## ポールニュース

April 2015

Vol.121

[編集発行]

日本ポール株式会社

マーケティング・コミュニケーショングループ 〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1

**2**03 (6367) 1691

Editor-in-Chief : A.Miki

Graphic Designer : H.Shimogawa

Contributing Authors: K.Takagi

T.Fukuda K.Nyudo

A.Miki T.Namba

Y.Honma

S.Babasaki

M.Sumiya